# 粒子の表面物性と粒子間付着力

## 藤 正督・高橋 実

## 名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター 〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-19

# Surface Properties of Particle and Adhesion Force between Particles

### Masayoshi FUJI and Minoru TAKAHASHI

Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology Asahigaoka 10-6-19, Tajimi 507-0071 Japan

Powders are frequently used in material processing such as fabrication of ceramics. For the control of dispersibility and cohesion, it is indispensable to understand the adhesion force between particles. The adhesion force is influenced by the environmental factors to which the powder is exposed and the properties of the particles. In handing powder, the surface changes caused by humidity are especially important. In this paper, the influence of humidity and the physico-chemical properties of particle surfaces on the adhesion between particles were reviewed.

#### 1.はじめに

粉体が関わる工業プロセスはセラミックスなどの固体 材料製造において欠くことができない。この場合,作製 された材料の良し悪しは粉体の分散,凝集状態に強く依 存する。例えば,不均一分散状態や凝集塊が有る状態で セラミックを作製すると,密度不均一や欠陥を生じてし まう。この場合,本来期待されるような強度や性能に達 しない。一方,製剤などにおける造粒操作のように粉体 の凝集性を積極的に用いることもある。これら分散性, 凝集性など粉体特有の性質の源は粒子間の付着力にあ る。それゆえ粉体の関与する各種プロセスにおいて,付 着力がうまく利用される場合も,トラブルの原因となる 場合も,付着力のコントロールは重大な関心事の一つで ある。

付着力は通常Van der Waals 力,静電引力,液架橋力, 固体架橋力等の要因で生じる力の総和とみなされる。理 論的解析も実験的検証もすすみ,理想的な系においては 分子レベルからマクロのレベルまで体系づけられつつあ る<sup>1)</sup>。しかしながら,身近で起こる各種粉体の付着性を 比較検討してみると,それが著しく大きい場合,あるい は逆に小さい場合が良く観察される。このような違いは 何によって引き起こされるのだろうか?もちろん付着力 の発生要因の差,すなわち前述したVan der Waals 力, 静電引力,液架橋力等の違いにより付着力の大きさは当 然異なるであろう。その他に付着力を左右する各種の重 要な要因が挙げられる。たとえば粉体が置かれている環 境や状態の差異,すなわち温度,湿度,あるいは粉体の 充填率の違いがある。また,粉体粒子自身の特性,たと えば粒子の大きさや,その形状,表面の物理的化学的特 性等に,付着力の大小は強く影響される。実際に粉体を 取り扱う場合において我々が観察する付着力は,これら 種々の要因が複合された結果であるため複雑な挙動を示 すのである。

本報では環境の要因影響として,湿度をとりあげるこ ととする。これは日本のような高湿度な国において特に 重要と思われるからである。また,粉体粒子自身の特性 としては粒子表面の物理的化学的特性について述べる。 また両者が互いに密接な関係に有ることについても言及 する。

#### 2.幾何学的構造と物理吸着水を考慮した粒子表面

粒子径が数十µm以下になると,粉体の動力学は重力 支配から付着力支配に変わる。したがって,表面状態が 粉体の種々の現象に大きく影響をするようになる。表面 状態は表面化学的な変化に加え幾何学的構造因子も重要 である。また多くの場合,粉体が大気中で取り扱われる ことを考えると,物理吸着水の影響も,粒子間付着力を 左右する重要な要因である。そこでここでは,粒子間付 着力に影響するであろう粉体の表面幾何学的構造と物理 吸着水についてシリカを例として整理することにする。



Fig 1. Conceptual classification of surface structure. (a) smooth surface on molecular level, (b) surface with roughness on molecular level, (c) surface with micropore. (d) surface with mesopore.

付着力支配(表面支配)であるサブミクロン以下の粒子 を取り扱う場合、粒子間付着力に影響するであろう表面 幾何学構造は,粒子の大きさから判断して,ナノスケー ルの構造を考えればよいであろう。なぜならば,これよ リ大きな表面幾何学構造は,マクロポア(50nm以上)も 含めて概ね粒子形状の範疇と考えられる。そして,この スケールの表面幾何学構造は電子顕微鏡で十分観察で き、粒子形状と粒子間付着力の問題として取り扱えるか らである。この考えに基づき,かつ吸着分子と粒子の相 対的な大きさから,表面幾何学的構造は概ねFig.1 に示 す4つに分類できる。第一はFig.1(a)の原子レベルで平 滑な表面構造,第二は(b)の原子レベルのラフネスを 持つ表面構造,第三の(c)はマイクロポアを有する表 面構造,第四の構造(d)はメソポアを有する表面構造 である。これらの表面構造の分類にしたがい,各表面構 造と物理吸着水の状態について次に述べる。

#### 2.1 原子レベルで平滑な粒子表面

この表面構造は理想的な無孔性粒子の場合である。このレベルは表面化学種に関係し,表面・界面化学的にみた粒子間付着力の基本要素となる。

シリカの場合,このレベルの最小単位としては,表面 水酸基が重要である。表面水酸基は化学的存在状態や化 学的構造からFig. 2 に示すような,freeタイプとH-bond タイプあるいはiso.タイプ,gem.タイプ,tri.タイプに分 類される。ただしtri.タイプは,その構造の不安定さから, 特殊な条件が整わない限り存在し得ない<sup>2)</sup>。したがって, 一般に,表面水酸基のタイプはiso.タイプおよびgem.タ イプの存在のみを意識すればよい。これらは次に示す原 子レベルのラフネスを持つ表面構造と深く関係してい る。

#### 2.2 原子レベルのラフネスを持つ粒子表面

前述したように,ステップ,キンクなど原子レベルで の表面ラフネスは表面水酸基の種類と深く関係してい る。Fig. 3 にこれらの関係を示唆するモデル図を示す<sup>3</sup>。 Fig. 3(a)は -クリストバライトの(111)面に生成した



Fig 2. Classification of surface silanol (a) according to chemical state, (b) according to chemical structure.

表面水酸基のモデル図である。この場合,結晶構造から 考えて,freeタイプでかつiso.タイプの表面水酸基しか生 成し得ない。Fig. 3(b)は同じく -クリストバライトの (100)面に生成した表面水酸基のモデルで,freeタイプ でかつgem.タイプの表面水酸基のみが生成可能である。 このように平滑面おいてはH-bondタイプ表面水酸基は存 在しない。 -クリストバライト構造において,H-bond タイプ表面水酸基は(111)面と(100)面間のエッジ部 などに存在しうる。すなわち,原子レベルでのラフネス や構造欠陥が存在しなければ,H-bondタイプ表面水酸基 は存在しないといえる。アモルファスシリカの正確な表 面構造を記述することは大変難しい。しかしながら,概 ねFig. 3(a)~(c)の構造が部分的に入り組んでいると 理解できる。

実際問題,完全平滑の粉体表面は有り得ない。つまり, Fig. 1(a)は(b)の特別な場合と考えられる。したがっ て,以降は両ケースを平滑表面あるいは無孔性粒子とし て取り扱う。

ここで示した表面水酸基は物理吸着水の吸着サイトと なる。大気雰囲気での取り扱いでは多くの場合、物理吸 着水が存在し,その存在量は湿度に依存し変化している。 Fig. 4 に比較的平滑な表面を持つといわれている気相合 成シリカの水蒸気吸着等温線を示す4),5)。図中の数字は 表面水酸基量を減少させる為に導入したトリメチルシリ ル基(TMS基)の表面密度である。改質基密度0.7nm<sup>-2</sup> の試料は水にぬれる親水性試料である。一方,改質基密 度0.8nm<sup>-2</sup>の試料はちょうど疎水性と変化し,水には分 散せず水面に浮遊する試料である。未改質試料及び両改 質試料いずれも初期吸着性の悪いIUPAC分類の 型を示 す等温線を示している。両改質試料に対する水蒸気吸着 量は、未改質試料の場合と比較して低相対圧域ではやや 低下している。一方,高相対圧域では両改質試料への水 蒸気吸着量は大きく低下し、未改質試料の吸着量と大き な差を生じている。改質基密度0.7nm<sup>-2</sup>の改質試料の場 合,この領域においては吸着量は未改質試料に比べ減少 するが,相対圧1に近づくと未改質試料みられるように 吸着量の増加が認められる。しかしながら、改質基密度 0.8nm<sup>-2</sup>の試料に対する吸着量は,相対圧1においても 理論的に算出される水の単分子吸着量0.35mlSTP/m2の



Fig 3. Surface structure of -cristobalite (a) iso. type silanol on (111) face, (b) gem. type silanol on (100) face, (c) mixed-surface of (a) and (b). : hydroxyl group, : silicon atom. Hydrogen bond is shown by shaded bar. Oxygen atoms in lattice are not shown.

65%程度にとどまっている。等温線が型であること, 低相対圧域での吸着量の減少,および高相対圧域での吸 着特性の差異は以下のように解釈できる。

低相対圧域の水蒸気吸着では,水分子と親和性の高い 表面水酸基上へまず局在化吸着し,次にこれを中心とし て共同吸着が起こり,吸着層は島状に成長する。この場 合,改質試料の水蒸気吸着量は,改質反応により減少す る表面水酸基量及び改質基の立体障害により遮蔽される 表面水酸基量分だけ,減少することが予想される。この ことは,Fig.4(a)の吸着量を残存水酸基に対する吸着水 分子の数に変換したFig.4(b)から確認できる。親水性 改質試料の場合,水酸基一個当たりの水蒸気吸着量は未 改質試料のものと一致することから,改質反応による表 面水酸基の減少量分だけ水蒸気吸着量が減量しているこ とがわかる。疎水性改質試料の場合,未改質試料の吸着 量を下回る。このことから,改質基が残存する表面水酸 基を遮蔽し,改質反応で減少した水酸基量から予測され る多くの吸着サイトが減少したと解釈できる。



Fig 4. Adsorption isotherms of water molecule on non-porous silica particle.

一方,未改質試料の高相対圧域では,低相対圧域で形 成された表面水酸基への局在化吸着を中心に共同吸着し た島状の吸着層が互いに接した2次元水膜を形成し、そ の上へ多層吸着が起こるために吸着量の増加がみられた ものと推定される。またこのような2次元水膜の連続的 形成がぬれ性に密接に関係し,かつ相対圧約0.7以降で起 こる粒子間への水蒸気毛管凝縮現象による急激な吸着量 増大の有無を決定している。親水性改質試料の場合,改 質により島状吸着層の間隔が広がり、かつ改質基が存在 するために2次元水膜の形成時期が未改質試料に比較し て高相対圧で起こる。従って,多分子層吸着および毛管 凝縮による水蒸気吸着量の増加時期も遅れるものと解釈 できる。一方,疎水性を示す改質試料の場合,吸着量は 相対圧1においても理論的単分子吸着量の65%(約) 0.22mISTP/m<sup>2</sup>)程度にとどまる。したがって,水蒸気吸 着は改質基の被覆部分以外のみに起こっており、また多 分子層が形成されないと判断できる。これは改質基の嵩 の影響により2次元方向への水膜の形成が抑制され連続 的2次元水膜が形成できなかったものと低相対圧部の吸 着過程の結果から推測される。したがって,高い水蒸気 圧下においても粒子間への毛管凝縮が起こらず,吸着量 は未改質試料および親水性改質試料の場合のような急激 な増加を示さないものと理解できる。

結局, Fig. 5 に示すように, 湿度が高くなるにつれ, 無孔性シリカ上の物理吸着水の状態は, 局在化吸着, 共 同吸着による島状吸着層の形成, 島状吸着層の接触によ る二次元連続水膜の形成, 粒子間への毛管凝縮相と変わ る。

#### 2.3 マイクロポアを有する粒子表面

第三の表面幾何学構造はマイクロポアが存在する場合 である(Fig.1(c))。水分子がマイクロポアフィリングを 起こすウルトラマイクロポア領域の表面構造の測定は, ヘリウム吸着による報告例<sup>())</sup>はあるが,一般的には水蒸 気吸着実験以外では測定が困難である。以下,水蒸気吸 着実験を用いたマイクロポアの解析とマイクロポアを持 つ液相合成シリカの物理吸着水の状態について示す。

Fig. 6 は液相合成により作製された未改質シリカ粉体, トリメチルシリル基密度1.2nm<sup>-2</sup>の改質試料及びトリメチ ルシリル基密度1.4nm<sup>-2</sup>の改質試料の水蒸気吸着等温線 である<sup>7)か</sup>。改質基密度1.2nm<sup>-2</sup>の試料は水に分散可能な 親水性試料である。一方,改質基密度1.4nm<sup>-2</sup>の試料は 水に分散せず水面に浮遊する疎水性試料である。また,



Fig 5. Adsorption mechanisms of water on non-porous silica particle.



Fig 6. Adsorption isotherms of water on microporous silica particle.

Fig. 6 には前述した無孔性シリカである気相合成シリカ の未改質試料の水蒸気吸着等温線も同時に示されてい る。未改質試料及び改質試料はいずれも初期吸着性の良 NIUPAC分類の 型を示す等温線である。未改質試料の 水蒸気吸着量が改質試料と比較して著しく大きくなって いる。一方,改質試料は親水性と疎水性の差があるにも 関わらず低相対圧域での吸着量はほぼ同量である。そし て,高相対圧域で親水性を示す改質基密度1.2nm<sup>-2</sup>試料 の吸着量が増加している。このような差異のあらわれた 吸着機構の検討は,無孔性シリカの水蒸気吸着等温線を 標準等温線として各試料の水蒸気吸着等温線をV-t プロ ットに変換することで解析可能である。無孔性シリカへ の水蒸気吸着等温線はIUPAC分類の 型等温線で,その 吸着機構は低相対圧域において水分子と親和性の高い表 面水酸基上へまず局在化吸着し,次にこれを中心として 共同吸着が起こり,吸着層は島状に成長する()5)。したが って, V-t プロットが直線を示す部分は無孔性シリカへ の水蒸気吸着機構と同じ機構であり,またプロットの屈 曲は吸着機構の変化であると判断できる。ただしこの場 合,吸着層の成長は島状であるので∀-t プロット横軸の 厚みは島状吸着層の幾何平均厚さ(マイクロポア半径) となり,実際の吸着層の厚み(マイクロポア半径)より も過小評価されることに注意が必要である。V-t プロッ トをFig. 7 に示す。未改質試料の場合,低膜厚域ではV-t プロットの傾きが大きくなっている。これは、マイクロ ポアへ水分子がフィリングしたためであると考えられ る。しかし,膜厚約0.08nmを越えるとほぼ無孔性シリカ と同じ傾きを持つ直線と一致している。ここで,無孔性 シリカの水蒸気吸着等温線では膜厚0.08nmは相対圧約0.7 における吸着層の厚みである。また,この相対圧での無 孔性シリカの水蒸気吸着量は,理論的単分子吸着量の約 30%である。したがって,水蒸気の吸着は島状吸着の形 成段階にあるといえる4)5)。つまり,プロットが同じ傾き



Fig 7. V-t plots of water adsorption on microporous silica and nonporous silica as standard.

を持つ直線となっているのはマイクロポア内への水のフィリングが終了し,外表面の水酸基および水分子のフィリングしたマイクロポアを活性点として無孔性シリカと 同様の島状吸着が始まったためだと考えられる。そして, その後は島状吸着が互いに接し2次元的に連続した水膜 を形成した後に多分子層吸着に発達する。したがって, Fig. 6 の高相対圧域での吸着量が著しく増加したものといえる。

一方, 改質試料のV-t プロットも低膜厚域では傾きが 大きくなり,吸着初期においては未改質試料の傾きとほ ぼ同じである。これは, 改質によるマイクロポアの閉塞 がトリメチルシリル基の生成しうるマイクロポアまでに しか起こらないことを示している。つまり、それ以下の 直径のマイクロポアは閉塞されず,未閉塞のポアに水分 子がフィリング可能なのである。トリメチルシリル基の 大きさから考えると、この閉塞されたマイクロポアの細 孔径は直径0.8nm前後であると考えられる。また,水分 子フィリング後のV-t プロットの傾きは未改質試料に比 較して小さい。これらのことから, 改質試料の外表面で は未改質試料と同じ機構で島状吸着が形成されるが,そ の量が改質量の増加とともに減少したことがわかる。さ らに, 改質基密度1.2nm<sup>-2</sup>と1.4nm<sup>-2</sup>の試料では, その改 質量にあまり大きな違いがない。したがって形成される 島状吸着の量もほぼ等しいと考えられる。その為, Fig. 6の中相対圧域までは改質基密度1.2nm<sup>-2</sup>, 1.4nm<sup>-2</sup>の試料 ともに吸着量に大きな差は見られない。しかし、高相対 圧域に入ると疎水性を示す改質基密度1.4nm<sup>-2</sup>の試料は島 状吸着が改質基の遮蔽障害を乗り越えて成長することが できないが,親水性を示す改質基密度1.2nm<sup>-2</sup>の試料は島 状吸着が改質基の間隙に成長して2次元的に連続した水 膜を形成し、その後、多分子層へと発達すると考えられ る。その為,高い相対圧域での吸着量が親水性である改 質基密度1.2nm<sup>-2</sup>の試料の方が大きくなっていると理解で きる。

結局,マイクロポアを有するシリカの水蒸気吸着機構 は,ポアへのフィリングさえ完了してしまえば,ポア外 表面のみを考えればよく,その吸着機構は無孔性シリカ すなわち平滑表面をもつシリカの場合とほぼ同じとみな せる。また,マイクロポアフィリングは極めて低い湿度 で起こる。したがって,粉体が低い湿度で取り扱われる 場合,水分子のマイクロポアフィリングはすでに完了し た状態にあると考えられる。よって,大気中での粒子間 付着力を考える場合は,マイクロポアを持つ表面も先に 示した無孔性シリカすなわち平滑表面と同等の取り扱い ができる。

### 2.4 メソポアを有する粒子表面

第四の表面幾何学構造はメソポアが存在する場合であ る。この領域は窒素吸着実験で測定可能である。また, 特定の条件がととのえば,透過型電子顕微鏡で観察可能 である。メソポアの粒子間付着力への影響を考える場合 には、メソポア内への吸着物質の毛管凝縮が起こるか否 かが重要な問題である。また、マイクロポアの場合とは 異なり、吸着物質の毛管凝縮が起こりうる圧力範囲が広 いため、粉体を取り扱う湿度で付着力が大きく異なる。 したがって、水蒸気存在下で粉体を取り扱う場合には表 面幾何学構造の中で最も重要なファクターとなる。この ことに関しては、後の「3.3 多孔性シリカの粒子間付着 力」に記すことにする。

通常の水蒸気存在下で親水性粉体を取り扱う場合, Fig.1に示した(a),(b),(c)の表面構造は水蒸気の 吸着の為にほぼ同じ状態あると理解できる。したがって, 粒子間付着への表面構造の影響を考える場合,(a)の平 滑表面と(d)のメソポア構造を考慮すれば良い。そこ で,次節は湿度下での両表面構造と付着力の関係につい て述べることにする。

3. 水蒸気存在下における粒子間付着力発生メカニズム

#### 3.1 無孔性シリカ粒子間の付着力(高湿度下)

種々の湿度で測定された約3µmの無孔性球形シリカ 粒子間の付着力をFig.8に示す<sup>3</sup>)。これらはカンチレバー およびシリコンウエハーに固定された粒子間の付着力を AFMにより測定した結果である。親水性試料として表面 水酸基密度4.6nm<sup>-2</sup>,3.6nm<sup>-2</sup>の未改質シリカとトリメチ ルシリル基表面密度0.42nm<sup>-2</sup>の改質シリカが用いられて いる。また,疎水性試料としてトリメチルシリル基表面 密度1.01nm<sup>-2</sup>,1.16nm<sup>-2</sup>のシリカが用いられている。 Fig.8から親水性試料は湿度約70%まで200N/m前後のほ ぼ一定した値を取り,70%以降急激に増加している。ま





た,立ち上がりが生じる湿度は親水性の減少に伴い高湿 度側にシフトしている。一方,疎水性試料は湿度90%に おいても単調な増加を示しており,急激な増加は見られ ない。この様な付着力の増加挙動は水蒸気吸着等温線の 変化と良い対応をしめしており,粒子間への毛管凝縮の 形成の有無と付着力に相関関係がある。つまり,親水性 試料においては粒子間に毛管凝縮が生じることにより, 液架橋力が加わり急激な上昇が現れたのに対し,疎水性 試料においてはトリメチルシリル基の立体障害により粒 子間の毛管凝縮が阻害され,単調増加にとどまったもの と考えられる。同様に,親水性試料において親水性の減 少により付着力の増大時期に遅れが生じたのも,トリメ チルシリル基の存在により粒子間への毛管凝縮開始が遅 延したためと理解できる。



Fig 9. Relationship between adsorption amount of water on nonporous silica particles and adhesion force.



Fig10. Formation of hydrogen bond between non-porous silica particles.

以上のように,高湿度における付着力変化は粒子間へ の毛管凝縮(液架橋)形成に依存し,先に述べたぬれ特 性変化の機構とも良い対応を示す。粒子表面上の物理吸 着水の存在状態が粒子間付着力へ大きくしていることが わかる。

3.2 無孔性シリカ粒子間の付着力(低湿度)

ここで言う低湿度とは,物理吸着水の存在状態を基準 として,粒子間毛管凝縮が起こる以前の湿度とする。水 蒸気の吸着量に対する付着力の変化をFig.9に示す。)。

Fig. 9 から全領域において水蒸気の吸着に伴い付着力 が上昇していることが分かる。この傾向は、空気中から 水中へと雰囲気が変化することで値が減少するファンデ ルワールス力とは反対の結果となっている。したがって ファンデルワールス力の寄与が小さいことを示してい る。また、プロットは親水性試料に帰属される緩やかな 直線と疎水性試料に帰属される傾きの大きな直線に分類 される。これは,疎水性試料では水蒸気の吸着に伴い付 着力が比例的に増加するのに対し、親水性試料では水蒸 気の吸着前から強い付着力が存在し、水蒸気吸着の影響 をあまり受けないことが示唆される。このことは, 付着 力が水素結合に起因すると考えると合理的に説明でき る。つまり, Fig.10に示すように, 疎水性試料において はトリメチルシリル基の立体障害により表面水酸基間で は水素結合を形成するとはできないが,吸着水分子を媒 介することで粒子表面間に水素結合が形成し得る。これ に対して,親水性表面では,はじめからシラノール基間 の結合が可能なため、水蒸気の吸着が生じても付着に寄 与する水素結合の総数には大きな変化は無く、値も大き く変化しないと考えられる。これらのことから、低湿度 における付着力発生は表面間の水素結合が支配的である といえる。

#### 600 △ nonporous 500 • 4.3 nm 5.2 nm □ 11.7 nm 19.5 nm 100 0 40 50 60 70 80 90 100 30 Relative Humidity (%rh)

Fig11. Adhesion force between mesoporous silica particles against humidity.

### 3.3 多孔性シリカの粒子間付着力

細孔径の異なる4種の多孔性球形シリカ粒子間の付着





Fig13. Illustration of adhesion model between mesoporous particles. (a) small pore radius, (b) large pore radius.

Fig12. The critical humidity where capillary condensation occurs into mesopore.

力と湿度の関係をFig.11に示す<sup>10)</sup>。前述した無孔性粒子 同様,付着力はAFMにより測定されている。細孔径の小 さい細孔半径4.3nmおよび細孔半径5.2nmの試料では,高 相対圧に近づくにつれて鋭い立ち上がりが見られる。一 方,細孔半径11.7nmおよび細孔半径19.5nmの細孔径の大 きい試料に対する付着力は,湿度が高くなるにつれ単調 な増加を示している。これらの差異は細孔内への水の毛 管凝縮と粒子間への毛管凝縮と深い関係がある。Fig.12 はKelvin式と水蒸気吸着等温線から各湿度において水が どの程度細孔に毛管凝縮するかを算出し,細孔径分布と 重ね合わせて比較した結果であるい。小さい細孔半径 4.3nmおよび細孔半径5.2nmの試料では湿度80%RHで充 填が完了するのに対して,細孔半径11.7nmおよび細孔半 径19.5nmの細孔径の大きい試料では90%RHに至っても 毛管凝縮が完了しなていことがわかる。これは,付着力 測定において小さい細孔半径4.3nmおよび細孔半径5.2nm の試料では70から80%RHで付着力が増加した結果と対応 している。一方,細孔径の大きい細孔半径11.7nmおよび 細孔半径19.5nmの試料においては90%RHにおいても細 | 孔への水の毛管凝縮が続くため , 付着力が増加していな いと考えられる。つまりFig.13に示すように,細孔径の 小さな試料では、低い湿度において毛管凝縮が完了し粒 子外表面に連続水膜が形成し、つづいて起こる粒子間毛 管凝縮に伴い液架橋が形成され、付着量は増大する。一 方、細孔径が大きい場合、細孔内への吸着及び毛管凝縮 の完了はかなり高湿度であり,ほとんどの温度下で粒子 外表面には細孔構造で寸断された不連続水膜しか形成さ れない。このため,部分的な液架橋形成は可能であるが, 無孔性や細孔径の小さな試料のように粒子間に完全な液 架橋が生成しえない。したがって,かなりの高湿度に至 っても付着力の増加が認められないものと考えられる。

#### 4.おわりに

水蒸気存在下での粒子間付着力は,粒子表面での水吸 着層の状態と粒子表面の幾何学的構造に影響される。粒 子間毛管凝縮が起こる前の低湿度における付着力の主要 因は,水の介在による粒子表面間の水素結合である。粒 子間毛管凝縮が起こった後の高湿度下での付着力の主要 素は液架橋力である。細孔を有する粒子の場合も基本的 な付着発生メカニズムは同じである。粒子間毛管凝縮が 起こる前の低湿度では,水の介在による粒子間水素結合 が付着力の主要因である。ただし、メソポアの存在によ る接触面積の低下分だけ無孔性粒子に比較して付着力は 低下する。粒子間毛管凝縮が起こった後の湿度でかつ細 孔への毛管凝縮が完了する湿度以降においては,無孔性 粒子の場合とほぼ同等の液架橋力が働く。一方,細孔へ の毛管凝縮が完了する以前の湿度においては、部分的な 接触部における液架橋力のみが可能で、細孔内への毛管 凝縮完了後に比較して大きな付着力は発生しえない。

以上のことから,粉体を取り扱う湿度に置いて,その 粉体の持つ細孔径が毛管凝縮半径以上である場合,付着 力は部分的液架橋力もしくは水の介在による水素結合力 のみであり,強い凝集構造を形成しにくいことが予想さ れる。たとえば,セラミックススラリーやサスペンジョ ンの均質化がこの条件では可能であろう。一方,造粒の ために凝集を積極的に起こすためには,逆の条件を設定 すればよい。今後,材料プロッセッシングの目的,条件 に応じて粉体表面をコントロールすることができるよう に成れば,机上で設計された材料を効率良く再現し作製 することが可能となるであろう。

最後に著者の興味から内容的に偏った面も多分にある と思われる。付着に関しては各種の総説<sup>11-17)</sup>も多いので それらを参考にして補っていただければ幸いである。

#### 参考文献

- 1 ) J. N. Israelachvilli, "Intermolecular and Surface Forces" p.312, Academic Press (1992).
- 2)日本化学会, "コロイド化学 基礎および分散・ 吸着" p.87,東京化学同人(1995).
- 3 ) D. W. Sindorf, G. E. Maciel , J.Am.Chem.Soc., 105, 1487 (1983)
- 4) M. Fuji, H. Iwata, T. Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa, Adv. Powder Technol., 10, 187 (1999)
- 5)藤 正督,岩田宏敬,武井 孝,渡辺 徹,近沢正 敏,粉体工学会誌,32,649 (1995)

- 6 ) N. Setoyama, M. Ruike, T. Kasu, T. Suzuki and K. Kaneko, Langmuir, 9, 2612 (1993).
- 7) M. Fuji, H. Iwata, T. Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa, Adv. Powder Technol., 8, 325 (1997)
- 8)藤正督,岩田宏敬,武井孝,渡辺 徹,近沢正 敏,粉体工学会誌,33,740 (1996)
- 9 ) M. Fuji, K. Machida, T. Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa , Langmuir, 15, 4584 (1999)
- 10) M. Fuji, K. Machida, T.Takei, T. Watanabe and M. Chikazawa, J. Phys. Chem., 102, 8782 (1998)
- 11) 金沢孝文, 近沢正敏, 粉体と工業, 4, 62 (1986)
- 12) 近沢正敏,武井 孝,日本海水学会誌,41,168 (1987)
- 13) 金沢孝文,近沢正敏,次田 章,石膏と石灰,171, 79 (1981)
- 14) 金沢孝文,近沢正敏,次田 章,石膏と石灰,172, 114 (1981)
- 15) 金沢孝文,近沢正敏,次田 章,石膏と石灰,173, 165(1981)
- 16 ) W. B. Pietsch , Trans. ASME, B91, 435 (1969 )
- 17 ) H. Rumpf , Chem. Ing. Tech., 30, 144 (1958)